

## DCスパッタ装置 SP-15000D



実験用の小型装置ですが、大型ターゲットとクライオポンプによるドライ系排気が特徴です。AlやAl-Si膜のように、残留ガス(酸素、水分等)の存在が問題になるようなスパッタリング実験に適しています。設置床面積も小さく、使い易い装置です。

### DCスパッタ装置SP-15000D仕様

○到達圧力	×10 <sup>-5</sup> Pa台※常温・無負荷・脱ガス時
○排気速度	×10 <sup>-4</sup> Pa台迄15分以内※常温・無負荷・脱ガス時
○成膜室径	φ450mm×250mmH SUS304 電解研磨
○スパッタ用電源	DC電源700V 5KW 1台
○基板形状	4インチ 1枚
○膜厚分布	±15%以内
○ターゲット寸法	6インチ(金属膜)
○ターゲット個数	1
○基板回転	無し
○基板加熱	常温～300℃迄昇温可能
○真空排気系	油回転ポンプ:253L/min クライオポンプ:680L/sec
○操作方法	手動
○ガス系統	マスフローコントローラ 1系統
○ユーティリティ	電気:AC200V三相16KVA 冷却水:15L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環 計装エア:0.5MPa以上 設置寸法:1200mmW×1000mmD×1500mmH